WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationale Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 94/08074

C25D 11/36

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

14. April 1994 (14.04.94)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP93/02538

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. September 1993 (20.09.93)

CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(30) Prioritätsdaten:

P 42 32 292.8

28. September 1992 (28.09.92) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HEN-KEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE]; D-40191 Düsseldorf (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SPECKMANN, Horst-Dieter [DE/DE]: Eichenseldstrasse 24a, D-40764 Langenfeld (DE). SEIDEL, Reinhard [DE/DE]; Ottilie-Baader-Weg 29, D-40789 Monheim (DE). VELDMAN, Gerard [NL/NL]; Boutestrasse 30, NL-6071 KT Swalmen (NL). BRANDS, Karl-Dieter [DE/DE]; Gänsestrasse 1, D-40593 Düsseldorf (DE).

(54) Title: PROCESS FOR PHOSPHATING GALVANISED STEEL SURFACES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM PHOSPHATIEREN VON VERZINKTEN STAHLOBERFLÄCHEN

(57) Abstract

The invention relates to a process for phosphating galvanised steel surfaces, preferably electrolytically or hot-dip-galvanised surfaces of steel strip, by treating them in a bath or spray with acid, aqueous phosphating solutions, with the workpieces given a d.c. cathodic treatment at the same time. In the process: a) phosphating solutions are used containing the following components: Zn²⁺ cations in the range from 0.1 to 5 g/l, PO₄³-anions in the range from 5 to 50 g/l, NO₃- anions in the range from 0'.1 to 50 g/l, and Mn²⁺ cations in the range from 0.1 to 5 g/l, and Cu²⁺ cations in the range from 0.001 to 1 g/l; b) the following conditions are observed: pH of the phosphating solution in the range from 1.5 to 4.5, temperature of the phosphating solution in the range form 10 to 80 °C, treatment time in the range from 1 to 300 sec; c) and the workpieces are also cathodically treated with a direct current with a density in the range from 0.01 to 100 mA/cm² during phosphating.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Phosphatieren von verzinkten Stahloberflächen, vorzugsweise elektrolytischoder schmelztauchverzinkten Stahlband-Oberflächen, durch Behandeln derselben im Tauchen oder Spritztauchen mit sauren, wäßrigen Phosphatierlösungen, wobei man gleichzeitig die Werkstücke kathodisch mit einem Gleichstrom behandelt. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß man a) mit Phosphatierlösungen arbeitet, die die folgenden Komponenten enthalten: Zn²⁺-Kationen im Bereich von 0,1 bis 5 g/l, PO₄³-Anionen im Bereich von 5 bis 50 g/l, NO₃-Anionen im Bereich von 0,1 bis 50 g/l, sowie Mn2+-Kationen im Bereich von 0,1 bis 5 g/l, und Cu2+-Kationen im Bereich von 0,001 bis 1 g/l; b) wobei man die folgenden Bedingungen einhält: pH-Wert der Phosphatierlösungen im Bereich von 1,5 bis 4,5, Temperatur der Phosphatierlösungen im Bereich von 10 bis 80 °C, Behandlungsdauer im Bereich von 1 bis 300 sec; c) und wobei man ferner während der Phosphatierung die Werkstücke kathodisch mit einem Gleichstrom einer Dichte im Bereich von 0,01 bis 100 mA/cm² behandelt.

RNSDOCID: <WO 9408074A1 | >

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	Fl	Finnland	MR	Mauritanien
AU	Australien	FR	Frankreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GA	Gabon	NE	Niger
BE	Belgien	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GN	Guinea	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	GR	Griechenland	NZ	Neusceland
BJ	Benin	HU	Ungarn	PL	Polen
BR	Brasilien	ΙΕ	Irland	PT	Portugal
BY	Belarus -	īī	Italien	RO	Rumänicn
		JР	Japan	RU	Russische Föderation
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SD	Sudan
CF	Zentrak Afrikanische Republik	KR	Republik Korca	SE	Schweden
CC	Kongo	K2	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakischen Republik
CI	Côte d'Ivoire		Sri Lanka	SN	Senegal
СМ	Kamerun	LK		TD	Tschad
CN	China	LU	Luxemburg	ŤĞ	Togo
CS	Tschechoslowakei	LV	Lettland	ÜA	Ukraine
CZ	Techechischen Republik	MC.	Моласо	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DE	Deutschland	MG	Madagaskar	US UZ	Usbekistan
DK	Dânemark	ML	Mali		
ES	Spanien	MN	Mongolci	VN	Victnam

BNSDOCID: <WO_____9408074A1_i_>

. 1

"Verfahren zum Phosphatieren von verzinkten Stahloberflächen"

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Phosphatieren von verzinkten Stahloberflächen, vorzugsweise von elektrolytischoder schmelztauchverzinkten Stahlband-Oberflächen, durch Behandeln derselben im Tauchen oder Spritztauchen mit sauren, wäßrigen Lösungen, die neben Zink-, Phosphat- und Nitrat-Ionen ferner Ionen mindestens zweier weiterer zweiwertiger Metalle enthalten, wobei man gleichzeitig die Werkstücke kathodisch mit einem Gleichstrom behandelt.

Es ist dem Fachmann bereits seit geraumer Zeit bekannt, daß hohe Anteile an Schwermetallionen, insbesondere Nickelionen, in Phosphatschichten zu einem besonders guten Korrosionsschutz führen, vergleiche beispielsweise die WO-A-85/03 089. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch bekannt, daß zur Erzielung hoher Nickelanteile in Phosphatschichten gleichfalls hohe Nickelanteile in den zu verwendenden Phosphatierlösungen erforderlich sind. Dies bedingt zum einen höhere Verfahrenskosten aufgrund des hohen Nickelpreises. Zum anderen müssen größere Mengen toxischer Nickel-Verbindungen aus den verbrauchten Phosphatierlösungen entsorgt werden, da in der Regel nur etwa 2 % des Nickels aus den Phosphatierlösungen in die Phosphatschichten eingebaut werden.

Aus ökologischen und arbeitsphysiologischen Gründen ist man daher bestrebt, auf das als toxikologisch besonders bedenklich eingestufte Nickel zu verzichten, ohne Nachteile hinsichtlich Korrosionsschutz und Lackhaftung in Kauf nehmen zu müssen. In der EP-A-459 541 wird hierzu der Einsatz von Phosphatierlösungen vorgeschlagen, die neben 0,3 bis 1,7 g/l Zink und 0,2 bis 4,0 g/l Mangan noch 1 bis 30 mg/l Cu(II) enthalten.

Der positive Einfluß von Kupfer auf die Ausbildung der Phosphatschicht ist im Stand der Technik schon seit längerem bekannt, vergleiche beispielsweise W. Rausch, "Die Phosphatierung von Metallen", Eugen G. Leuze Verlag, 2. Auflage 1988, Seiten 20, 56, 79f und 107. Die Kupferionen können dabei dem Phosphatierbad selbst oder einem vorgeschalteten Aktivierungsbad, beispielsweise auf Basis kolloider Titanpolyphosphate, zugesetzt werden. Beispielsweise beschreibt die EP-A-454 211 ein Titanphosphat-haltiges Aktivierungsbad, dem Kupfer im Mengenbereich von 1 bis 100 mg/l zugesetzt wird. Aber auch für titanfreie Aktivierungsbäder, wie sie beispielsweise in der EP-A-340 530 beschrieben werden, ist ein günstiger Einfluß eines Kupfergehaltes im Mengenbereich zwischen 1 und 100 mg/l zu erwarten.

Ferner ist die Anwendung von elektrischem Strom bei Phosphatierverfahren an sich bekannt. So führt eine kathodische Behandlung beispielsweise zu einer Beschleunigung des Phosphatierverfahrens (vergleiche M. H. Abbas, Finishing, Oktober 1984, Seiten 30-31). Auf verzinkten Stahloberflächen lassen sich mit Hilfe saurer, wäßriger Lösungen auf Basis von Aluminiumphosphat und/oder Magnesiumphosphat bzw. polykondensierter Phosphorsäure und gleichzeitiger Anwendung kathodischer Ströme Korrosionsschutzschichten abscheiden (vergleiche JP-A-77/047 537, JP-A-75/161 429 und JP-A-89/219 193). Die JP-A-85/211 080 betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von

Korrosionsschutzschichten auf Metalloberflächen mit Hilfe von Zink-Phosphatierlösungen unter zeitweiliger Anwendung eines kathodischen Stromes. Hierbei wird insbesondere auch an den Kanten der zu behandelnden Metalloberflächen eine korrosionsbeständige Schutzschicht erzeugt. Ein ähnliches Verfahren wird in der EP-A-171 790 beschrieben. Hierbei werden die Metalloberflächen im Anschluß an eine übliche Zink-Phosphatierung mit einer sauren, wäßrigen Lösung behandelt, die Zink-, Phosphat- und Chlor-Ionen enthält, wobei man an die anodisch geschalteten Metalloberflächen gleichzeitig einen Gleichstrom anlegt.

JP-A-87/260 073 können mit. Hilfe saurer Gemäß der Phosphatierungsbäder, welche Phosphorsäure, Mangan- und Kupfer-Ionen enthalten, unter gleichzeitiger Anwendung kathodischer Ströme auf Eisenmaterial Phosphatschichten mit hoher Abriebfestigkeit erzeugt werden. Die Phosphatierung von oberflächenveredeltem Material sowie der gleichzeitige Einsatz von Zink-Ionen wird jedoch hier nicht erwähnt. Eine Phosphatierung von elektrolytischschmelztauchverzinkten Stahloberflächen mit Hilfe dieses Verfahrens führte nicht zum gewünschten Erfolg.

In der bislang unveröffentlichten deutschen Patentanmeldung P 41 11 186.9 der Anmelderin wird ferner ein Verfahren zum Phosphatieren von Metalloberflächen, vorzugsweise von elektrolytisch- oder schmelztauchverzinkten Stahlband-Oberflächen, mit Hilfe saurer, wäßriger Phosphatierlösungen beschrieben, wobei man die Werkstücke gleichzeitig kathodisch mit einem Gleichstrom behandelt. Die hierbei verwendeten Phosphatierlösungen enthalten Zink-, Nickelund/oder Kobalt-Kationen sowie Phosphat- und Nitrat-Anionen.

Demgegenüber ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Phosphatieren von verzinkten Stahloberflächen bereitzustellen, bei welchem man – trotz des bewußten Verzichts auf den Einsatz der heute unerwünschten Nickel-Ionen – durch die Verwendung von Mangan-Ionen in den Zink-haltigen Phosphatierlösungen einen vergleichbar guten Korrosionsschutz erzielt. Zudem ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Einbaurate des Mangans in den ausgebildeten Phosphatüberzügen wesentlich zu steigern, obgleich in den verwendeten Phosphatierlösungen nur vergleichsweise geringe Konzentrationen an Mangan-Kationen vorliegen.

Dementsprechend betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Phosphatieren von verzinkten Stahloberflächen, vorzugsweise von elektrolytisch- oder schmelztauchverzinkten Stahlband-Oberflächen, durch Behandeln derselben im Tauchen oder Spritztauchen mit sauren, wäßrigen Lösungen, die neben Zink-, Phosphat- und Nitrat-Ionen ferner Ionen mindestens zweier weiterer zweiwertiger Metalle enthalten, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß man

a) mit Phosphatierlösungen arbeitet, die die folgenden Komponenten enthalten:

 Zn^{2+} -Kationen im Bereich von 0,1 bis 5 g/l,

 $P04^{3}$ -Anionen im Bereich von 5 bis 50 g/1,

NO3--Anionen im Bereich von 0,1 bis 50 g/l,

sowie

 Mn^{2+} -Kationen im Bereich von 0,1 bis 5 g/l,

und

 Cu^{2+} -Kationen im Bereich von 0,001 bis 1 g/1,

b) wobei man die folgenden Bedingungen einhält:

pH-Wert der Phosphatierlösungen im Bereich von 1,5 bis 4,5,

Temperatur der Phosphatierlösungen im Bereich von 10 bis 80 °C,

Behandlungsdauer im Bereich von 1 bis 300 Sekunden,

c) und wobei man ferner während der Phosphatierung die Werkstücke kathodisch mit einem Gleichstrom einer Dichte im Bereich von 0.01 bis 100 mA/cm² behandelt.

Überraschenderweise wurde nämlich festgestellt, daß durch das Anlegen eines kathodischen Gleichstroms an das Werkstück während der Phosphatierung und durch die gleichzeitige Anwesenheit von Kupfer-Kationen in den Zink-haltigen Phosphatierlösungen die Einbaurate von Mangan in die Phosphatschichten wesentlich gesteigert werden kann, so daß auch bei vergleichsweise geringeren Konzentrationen an Mangan-Kationen in der Phosphatierlösung ähnlich hohe Gehalte in den Phosphatierschichten erzielt werden können, wie es bislang nur dann möglich war, wenn die Phosphatierlösungen vergleichsweise hohe Konzentrationen an Mangan-Kationen aufweisen. Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung ist darin zu sehen, daß die mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens erzielten Phosphatierschichten einen vergleichbar guten Korrosionsschutz aufweisen, wie er sonst mit Nickel-haltigen Phosphatierlösungen erzielt werden kann.

Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist es von wesentlicher Bedeutung, daß man bei der Durchführung des Phosphatierverfahrens sämtliche der vorstehend aufgeführten Parameter einhält. Mit anderen Worten heißt dies, daß die kathodische Gleichstrombehandlung der Werkstücke während der Phosphatierung nur in entsprechenden Zinkhaltigen Phosphatierlösungen, die Mangan- und Kupfer-Kationen gemeinsam enthalten, – wie sie vorstehend im einzelnen definiert sind – zu dem erwünschten Ziel führt.

Wenn im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung von verzinkten Metalloberflächen die Rede ist, so werden darunter Werkstoff-Ober-flächen aus elektrolytisch- oder schmelztauchverzinktem oder auch

legierungsverzinktem Stahl, vorzugsweise elektrolytisch- oder schmelztauchverzinktem Bandstahl, verstanden. Unter dem Begriff Stahl wird un- bis niedrig-legierter Stahl verstanden, wie er beispielsweise in Form von Blechen für den Karosseriebau Verwendung findet. Die Verwendung von verzinktem Stahl, speziell elektrolytisch verzinktem Stahl in Bandform, hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Hierbei umfaßt der Begriff "verzinkter Stahl" sowohl Verzinkungen durch elektrolytische Abscheidung als auch durch Schmelztauch-Applikation und bezieht sich generell auch auf legierungsverzinkten Stahl, wobei als Zinklegierungen insbesondere Zink/Nickel-Legierungen, Zink/Eisen-Legierungen (Galvanealed) und Zink/Aluminium-Legierungen (Galfan, Galvalume) eine wesentliche Rolle spielen.

Die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt vorzugsweise im sogenannten Tauchverfahren; generell ist es jedoch auch möglich, die erfindungsgemäßen Phosphatierlösungen durch Spritztauchen auf die Substratoberflächen aufzubringen. Die zu behandelnden Werkstücke werden für die Phosphatierbehandlung kathodisch geschaltet, wobei als Gegenelektrode beispielsweise eine Elektrode aus Edelstahl Verwendung findet. Generell kann auch ein Metallbehälter des Phosphatierbades als Gegenelektrode dienen, ferner kommen auch Graphit-Elektroden, Edelmetall-Elektroden, beispielsweise aus Platin oder Gold, Elektroden, die lediglich eine Beschichtung aus den genannten Edelmetallen aufweisen oder in die derartige Edelmetalle implatiert sind, oder prinzipiell alle aus dem einschlägigen Stand der Technik bekannten Elektroden-Materialien als Gegenelektrode in Frage.

Im Sinne der vorliegenden Erfindung werden unter dem Begriff "Gleichstrom" nicht nur "reine" Gleichströme verstanden, sondern vielmehr auch praktisch gleichartige Ströme, beispielsweise solche, die durch Vollweggleichrichtung eines Einphasenwechselstroms oder durch Gleichrichtung eines Dreiphasenwechselstroms erzeugt werden können. Auch sogenannte pulsierende Gleichströme und zerhackte Gleichströme sind im Sinne der Erfindung anwendbar. Von Bedeutung im Sinne der Erfindung ist lediglich die Stromdichte des Gleichstroms, welche in dem vorstehend definierten Bereich liegen soll. Auf die Angabe von geeigneten Spannungswerten für den Gleichstrom, der im Sinne der vorliegenden Erfindung Verwendung finden soll, wird bewußt verzichtet, da unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Leitfähigkeiten der Phosphatierbäder einerseits und der geometrischen Anordnung der Elektroden andererseits ein unterschiedlicher Zusammenhang zwischen Strom und Spannung bestehen kann. Darüber hinaus sind für den Bildungsmechanismus der Phosphatierschichten Konzentrationsgradienten entscheidend, welche durch die Stromdichte und nicht durch die Badspannung bestimmt werden. Der Fachmann wird im Einzelfall für die Durchführung erfindungsgemäßen Verfahrens anhand der angegebenen Werte für die Stromdichte geeignete Spannungswerte auswählen.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung arbeitet man mit Phosphatierlösungen, die die folgenden Komponenten enthalten:

 Zn^{2+} -Kationen im Bereich von 0,5 bis 2 g/l, $P0_4^{3-}$ -Anionen im Bereich von 10 bis 20 g/l, $N0_3^-$ -Anionen im Bereich von 1 bis 30 g/l sowie Mn^{2+} -Kationen im Bereich von 0,5 bis 2 g/l und Cu^{2+} -Kationen im Bereich von 0,01 bis 0,5 g/l.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens hält man bei der Phosphatierbehandlung der Werkstücke die folgenden Bedingungen ein:

pH-Wert der Phosphatierlösungen im Bereich von 2 bis 3, Temperatur der Phosphatierlösungen im Bereich von 40 bis 70 °C, Behandlungsdauer im Bereich von 2 bis 30 Sekunden.

Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist es ferner bevorzugt, daß man während der Phosphatierung die Werkstücke kathodisch mit einem Gleichstrom einer Dichte im Bereich von 1 bis 50 mA/cm² behandelt.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens können die Phosphatierbäder ferner zusätzlich Magnesium-Kationen enthalten. Der Einbau dieser Kationen in die Phosphatierschicht wird zwar durch die erfindungsgemäße Anwendung des Gleichstromes nicht wesentlich gefördert, jedoch auch in keiner Weise gestört.

In diesem Sinne ist es erfindungsgemäß bevorzugt, daß man mit Phosphatierlösungen arbeitet, die zusätzlich Mg²⁺-Kationen im Bereich von 0,01 bis 2 g/l, vorzugsweise von 0,1 bis 1 g/l, enthalten. Die zusätzliche Verwendung von Magnesium-Kationen in den erfindungsgemäßen Phosphatierbädern bedingt eine Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit der hiermit erzielten Phosphatierschichten.

Im Falle der Phosphatierung von schmelztauchverzinkten oder legierungsverzinkten Stahloberflächen mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens führt der Einsatz von Fluoridionen zu einem gleichmäßigeren Deckungsgrad der Phosphatierschichten auf derartigen Oberflächen. In diesem Sinne ist es erfindungsgemäß bevorzugt, daß man mit Phosphatierlösungen arbeitet, die zusätzlich

einfache oder komplexe Fluorid-Anionen im Bereich von 0,1 bis 50 g/l, vorzugsweise von 0,2 bis 2 g/l, enthalten. Bei der Phosphatierung von elektrolytisch-verzinkten Stahloberflächen ist die Anwesenheit von Fluorid-Anionen nicht erforderlich, jedoch stört die Anwesenheit von Fluorid-Anionen das erfindungsgemäße Phosphatier-Verfahren auch in diesen Fällen nicht. Die Fluorid-Anionen können erfindungsgemäß auch in Form komplexer Fluorverbindungen, beispielsweise Tetrafluorborat oder Hexafluorosilicat, eingesetzt werden.

Wie bereits ausgeführt, ist für die optimale Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens die Einhaltung aller vorstehend genannten Parameter von wesentlicher Bedeutung. Hierzu zählt unter anderem der angegebene Bereich des einzuhaltenden pH-Wertes. Sollte der pH-Wert des Phosphatierbades nicht im angegebenen Bereich liegen, so ist es erforderlich, das Phosphatierbad auf pH-Werte im angegebenen Bereich durch Zugabe von Säure, beispielsweise Phosphorsäure, oder aber durch Zugabe einer Lauge, beispielsweise Natronlauge, einzustellen. Sofern in den nachstehenden Beispielen Werte zum Gehalt der Phosphatierlösungen an freier Säure bzw. an Gesamtsäure angeführt sind, so wurden diese in der in der Literatur beschriebenen Art und Weise ermittelt. Die sogenannte Punktzahl an freier Säure wird dementsprechend definiert als die Anzahl ml von N NaOH, die zur Titration von 10 ml Badlösung Dimethylgelb, Methylorange oder Bromphenolblau erforderlich ist. Die Punktzahl der Gesamtsäure ergibt sich hiernach als die Anzahl ml von 0,1 N NaOH, die bei der Titration von 10 ml Badlösung unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator bis zur ersten Rosafärbung erforderlich ist. Die erfindungsgemäßen Phosphatierlösungen weisen in der Regel Punktzahlen an freier Säure im Bereich von 0,5 bis 3 und an Gesamtsäure im Bereich von 15 bis 25 auf.

Die Herstellung der Phosphatierungsbäder zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt im allgemeinen in der üblichen Weise, die dem Fachmann an sich bekannt ist. Als Ausgangsprodukte zur Herstellung des Phosphatierungsbades kommen beispielsweise die folgenden Verbindungen in Betracht: Zink: in Form von Zinkoxid oder Zinknitrat: Mangan: in Form von Mangancarbonat; Kupfer: in Form von Kupfernitrat; Magnesium: in Form von Magnesiumnitrat, Magnesiumoxid, Magnesiumhydroxid oder Magnesiumhydroxycarbonat; Phosphat: vorzugsweise in Form von Phosphorsäure; Nitrat: in Form der vorstehend genannten Salze, gegebenenfalls auch in Form des Natriumsalzes. Die gegebenenfalls im Bad zu verwendenden Fluoridionen werden bevorzugt in Form von Natriumfluorid oder in Form der vorstehend genannten komplexen Verbindungen eingesetzt. Die vorstehend genannten Verbindungen werden - in den für die Erfindung wesentlichen Konzentrationsbereichen - in Wasser aufgelöst; anschlie-Bend wird, wie gleichfalls vorstehend bereits gesagt, der pH-Wert der Phosphatierungslösungen auf den gewünschten Wert eingestellt.

Vor der eigentlichen Phosphatierungsbehandlung muß die zu behandelnde Metalloberfläche vollständig wasserbenetzbar sein. Hierzu ist es im allgemeinen erforderlich, die zu behandelnden Metalloberflächen nach an sich bekannten und im Stand der Technik hinreichend beschriebenen Verfahren zu reinigen und zu entfetten. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist es ferner bevorzugt, nach einer Spülung der gereinigten und entfetteten Werkstücke mit Wasser, vorzugsweise mit vollentsalztem Wasser, die zu phosphatierenden Werkstücke einer an sich bekannten Aktivierungs-Vorbehandlung zu unterwerfen. Insbesondere werden hierzu titanhaltige Aktivierungslösungen eingesetzt, wie sie beispielsweise in DE-A-20 38 105 oder DE-A-20 43 085 beschrieben werden. Demgemäß werden die anschließend zu phosphatierenden Metalloberflächen mit Lösungen behandelt, die im wesentlichen Titansalze als Aktivierungsmittel und

Natriumphosphat, gegebenenfalls zusammen mit organischen Komponenten, beispielsweise Alkylphosphonaten oder Polycarbonsäuren, enthalten. Als Titankomponente kommen bevorzugt lösliche Verbindungen des Titans, wie Kaliumtitanfluorid und insbesondere Titanylsulfat, in Frage. Als Natriumphosphat kommt im allgemeinen Dinatriumorthophosphat zum Einsatz. Titanhaltige Verbindungen und Natriumphosphat werden in solchen Mengenverhältnissen verwendet, daß der Titangehalt mindestens 0,005 Gew.-% beträgt, bezogen auf das Gewicht der titanhaltigen Verbindung und des Natriumphosphats.

Im Anschluß an diese Aktivierungsbehandlung erfolgt dann das eigentliche Phosphatierverfahren; die phosphatierten Metalloberflächen werden dann nachfolgend erneut mit Wasser, wiederum bevorzugt mit vollentsalztem Wasser, gespült. In bestimmten Fällen kann es von Vorteil sein, in einer nachfolgenden Verfahrensstufe die so erzeugten Phosphatschichten zu passivieren. Eine solche Passivierung ist immer dann sinnvoll und von Vorteil, wenn die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren phosphatierten Metalloberflächen anschließend lackiert oder auf andere Weise mit organischen Materialien beschichtet werden. Wie dem Fachmann hinreichend bekannt ist. kann eine derartige Passivierungsbehandlung beispielsweise mit verdünnter Chromsäure oder Mischungen von Chrom- und Phosphorsäure erfolgen. Die Konzentration der Chromsäure liegt dabei im allgemeinen zwischen 0,01 und 1 g/l. Eine Alternative hierzu stellt eine Passivierungsbehandlung mit chromfreien Produkten dar, wie sie beispielsweise in DE-A-31 46 265 oder DE-A-40 31 817 beschrieben ist. Sofern jedoch die phosphatierten Substrate anschließend zunächst einem mechanischen Verformungsprozeß unterworfen und nachfolgend erneut phosphatiert werden, wie dies zum Beispiel beim Karroseriebau in Frage kommt, so sollte eine Passivierungsbehandlung unterbleiben.

Die mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens erzeugten Phosphatierschichten sind auf allen Gebieten, auf denen Phosphatüberzüge angewendet werden, gut einsetzbar. Ein besonders vorteilhafter Anwendungsfall liegt in der Vorbereitung der Metalloberflächen für die Lackierung, beispielsweise durch Spritzlackierung oder Elektrotauchlackierung, oder für die Beschichtung mit organischen Folien.

Die nachfolgenden Beispiele schildern die erfindungsgemäße Arbeitsweise.

13

Beispiele

In der nachstehenden Tabelle 1 sind für die erfindungsgemäßen Beispiele 1 bis 3 sowie für die Vergleichsbeispiele 1 bis 3 die Zusammensetzungen der verwendeten Phosphatierbäder einschließlich der
jeweiligen pH-Werte sowie der Werte des Gehaltes an freier Säure
und Gesamtsäure angegeben.

Bei den erfindungsgemäßen Beispielen 1 bis 3 wurde jeweils an die Prüfbleche – während der gesamten Tauchbehandlung derselben in den jeweiligen Phosphatierbädern – ein kathodischer Gleichstrom mit unterschiedlichen Stromdichten angelegt; die jeweiligen Stromdichten sind in Tabelle 2 angegeben. Als Gegenelektrode diente in allen Fällen eine Elektrode aus Platin.

Demgegenüber wurde bei den Vergleichsbeispielen 1 bis 3 die Phosphatierung ohne eine derartige Gleichstrombehandlung durchgeführt. Die zu den Vergleichsbeispielen 1 bis 3 eingesetzten Phosphatierbäder entsprechend im übrigen denjenigen der erfindungsgemäßen Beispiele 1 bis 3.

Als Prüfbleche wurden - für alle Beispiele und Vergleichsbeispiele - elektrolytisch verzinkte Stahlbleche (Abmessungen: 10 cm x 20 cm x 0,7 cm; beidseitige Zinkauflage in einer Stärke von 7,5 µm) der Fa. Thyssen AG, Duisburg, eingesetzt. Die zu den jeweiligen Beispielen und Vergleichsbeispielen eingesetzten Prüfbleche wurden - bis auf die vorstehend erörterte Behandlung mit Gleichstrom - ansonsten in gleicher Weise gemäß den nachfolgend beschriebenen Verfahrensschritten behandelt:

1) Chemisches Reinigen und Entfetten unter Verwendung eines tensid- und phosphathaltigen alkalischen Reinigungsmittels (Ridoline^R C 1250 E, Fa. Henkel KGaA) in einer Konzentration von 2 Gew.-% in wäßriger Lösung, im Spritzverfahren bei ca. 60 °C im Verlauf von 3 Minuten.

- Spülen mit vollentsalztem Wasser bei Raumtemperatur im Verlauf von 30 Sekunden.
- 3) Aktivieren unter Verwendung eines titansalzhaltigen, wäßrigen Aktivierungsmittels (Fixodine^R 6, Fa. Henkel KGaA) in einer Konzentration von 0,2 Gew.-%, im Tauchverfahren bei Raumtemperatur im Verlauf von 5 Sekunden.
- 4) Phosphatieren im Tauchverfahren in den jeweiligen Phosphatierbädern gemäß Tabelle 1 bei 60 °C, die jeweilige Dauer der Phosphatierung ist in Tabelle 2 angegeben.
- 5) Spülen mit vollentsalztem Wasser bei Raumtemperatur im Verlauf von 30 Sekunden.
- 6) Trocknen bei 80 °C Objekttemperatur im Verlauf von 10 Minuten.

Nach dem Trocknen wurden die jeweiligen Prüfbleche mit einem kathodischen Elektrotauchlack auf Epoxidbasis (Aqualux R K, Fa. ICI, Hilden) beschichtet. Die Trockenfilmdichte betrug 18 \pm 2 μ m.

Anschließend erfolgte die Ermittlung des Korrosionsschutzes der jeweiligen Phosphatierschichten durch Bestimmung der Lackunterwanderung gemäß einem kathodischen Polarisationstest. Dazu wurden die jeweiligen Prüfbleche mit einem Einzelschnitt gemäß DIN 53 167 versehen und anschließend in eine 10 gew.-%ige wäßrige Na₂SO₄-Lösung bei einem Stromfluß von 0,75 A und einer Polarisationszeit von 40 Stunden eingetaucht. Die Auswertung der Lackunterwanderung erfolgte gemäß DIN 53 167 (siehe Tabelle 2).

Die Schichtgewichte der Phosphatierschichten wurden durch Differenzwägung ermittelt (Gewicht des Testbleches mit Phosphatschicht ./. Gewicht des Testbleches nach Ablösung der Phosphatschicht

mittels Chromsäure). Ferner wurden die Phosphatierschichten auf den jeweiligen Testblechen zur Bestimmung ihrer Zusammensetzung mit Chromsäure abgelöst und durch AAS-Spektroskopie analysiert.

Die bei den vorstehenden Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengestellt.

<u>Tabelle 1:</u> Zusammensetzung der Phosphatierbäder

Beispiel Nr.	Zn ²⁺		Mn ²⁺ weils	. •	P04 ³ -	рН	f. S. Punkte	
1	1,6	0,01	1,0	2,3	12,3	2,7	1,5	20
2	1,6	0,1	1,0	2,5	12,3	2,7	1,5	21
3	1,6	0,2	1,0	2,7	12,3	2,7	1,5	23
Vgl. 1	1,6	0,01	1,0	2,3	12,3	2,7	1,5	20
Vg1. 2	1,6	0,1	1,0	2,5	12,3	2,7	1,5	21
Vg1. 3	1,6	0,2	1,0	2,7	12,3	2,7	1,5	23

Vgl. = Vergleichsbeispiel; f. S. = freie Säure;

G. S. = Gesamtsäure

<u>Tabelle 2:</u> Strondichte, Dauer der Phosphatierung, Gehalt an Cu und Mn in den Phosphatierschichten, Schichtgewichte und Korrosionstestergebnisse

Beisp Nr.		Stromdichte [mA/cm ²]	Zeit [s]	Cu Gew%	Mn Gew%	Schicht- gewicht [g/m ²]	Lackunterwan- derung [mm]
1		5	5	Spuren	4,9	1,4	13
2		5	5 .	0,5	5,1	1,5	·9
3		2	5	0,7	5,1	1,8	9
3		5	5	0,7	6,1	1,8	7,5
3		5	30	0,6	7,1	2,7	6,0
3	,	10	5	0,8	7,8	2,0	7,0
Vgl.	1	0	5	Spuren	3,8	0,7	>20
Vgl.		0	5	0,5	4,2	1,2	>20
Vgl.		0	5	0,7	4,8	1,8	17
Vgl.	•	0	30	0,9	4,6	2,0	10

Ein Vergleich der Werte in Tabelle 1 - bezüglich der Zusammensetzung der jeweiligen Phosphatierbäder - mit denen der Werte in Tabelle 2 - bezüglich des Gehaltes an Mangan in den Phosphatierschichten - zeigt, daß aufgrund der erfindungsgemäßen Verfahrensweise mit geringeren Mangan-Konzentrationen in den Phosphatierbädern vergleichsweise hohe Gehalte dieser Kationen in den gebildeten Phosphatierschichten erzielt werden können. Dies führt - in vergleichbaren Fällen der erfindungsgemäßen Beispiele mit den Vergleichsbeispielen - zu einem deutlich verbesserten Korrosionsschutz.

Patentansprüche

 Verfahren zum Phosphatieren von verzinkten Stahloberflächen, vorzugsweise elektrolytisch- oder schmelztauchverzinkten Stahlband-Oberflächen, durch Behandeln derselben im Tauchen oder Spritztauchen mit sauren, wäßrigen Lösungen, die neben Zink-, Phosphat- und Nitrat-Ionen ferner Ionen mindestens zweier weiterer zweiwertiger Metalle enthalten,

dadurch gekennzeichnet, daß man

a) mit Phosphatierlösungen arbeitet, die die folgenden Komponenten enthalten:

 Zn^{2+} -Kationen im Bereich von 0,1 bis 5 g/1,

 PO_A^{3} -Anionen im Bereich von 5 bis 50 g/l,

NO₃-Anionen im Bereich von 0,1 bis 50 g/l,

sowie

 Mn^{2+} -Kationen im Bereich von 0,1 bis 5 g/l,

und

Cu²⁺-Kationen im Bereich von 0,001 bis 1 g/l,

- b) wobei man die folgenden Bedingungen einhält: pH-Wert der Phosphatierlösungen im Bereich von 1,5 bis 4,5,
 - Temperatur der Phosphatierlösungen im Bereich von 10 bis 80 °C.

Behandlungsdauer im Bereich von 1 bis 300 sec,

- c) und wobei man ferner während der Phosphatierung die Werkstücke kathodisch mit einem Gleichstrom einer Dichte im Bereich von 0,01 bis 100 mA/cm² behandelt.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man mit Phosphatierlösungen arbeitet, die die folgenden Komponenten enthalten:

 Zn^{2+} -Kationen im Bereich von 0,5 bis 2 g/l, $P0_4^{3-}$ -Anionen im Bereich von 10 bis 20 g/l, $N0_3^-$ -Anionen im Bereich von 1 bis 30 g/l, sowie Mn^{2+} -Kationen im Bereich von 0,5 bis 2 g/l und Cu^{2+} -Kationen im Bereich von 0,01 bis 0,5 g/l.

- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man bei der Phosphatierbehandlung der Werkstücke die folgenden Bedingungen einhält:

 pH-Wert der Phosphatierlösungen im Bereich von 2 bis 3,

 Temperatur der Phosphatierlösungen im Bereich von 40 bis 70 °C,

 Behandlungsdauer im Bereich von 2 bis 30 sec.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man während der Phosphatierung die Werkstücke kathodisch mit einem Gleichstrom einer Dichte im Bereich von 1 bis 50 mA/cm² behandelt.
- 5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man mit Phosphatierlösungen arbeitet, die zusätzlich Mg^{2+} -Kationen im Bereich von 0,01 bis 2 g/l, vorzugsweise von 0,1 bis 1 g/l, enthalten.
- 6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man mit Phosphatierlösungen arbeitet, die zusätzlich einfache oder komplexe Fluorid-Anionen im Bereich von 0,1 bis 50 g/l, vorzugsweise von 0,2 bis 2 g/l, enthalten.

- 7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man die zu phosphatierenden Werkstücke zuvor einer an sich bekannten Aktivierungs-Vorbehandlung, insbesondere mit titanhaltigen Aktivierungslösungen, unterwirft.
- 8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 als Vorbehandlung für eine nachfolgende Lackierung oder Beschichtung.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inten_onal Application No
PCT/FP 93/02538

		POI/Er 3.	0/ 02336
A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C25D11/36		
-		•	
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
	S SEARCHED		
IPC 5	documentation searched (classification system followed by classification symbols) C25D C23C		
1105	C23D C23C		· . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Document	ation searched other than minimum documentation to the extent that such documents ar	e included in the fields	searched
		•	
Electronic	data base consulted during the international search (name of data base and, where pract	ical, search terms used)	
		•	
		•	
		·	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	EP,A,O 459 541 (METALLGESELLSCHAFT AG) 4		
	December 1991	,	
	cited in the application		A constant
		•	
Α .	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 108, no. 12,	(4)	*
	March 1988, Columbus, Ohio, US; abstract no. 99045b.		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	YAMAGATA 'phosphating of iron alloy'		*
	page 290 ;		
	cited in the application		
	see abstract	•	
	& JP,A,62 260 073 (YAMATA MOTOR CO) 12 November 1987	:	
	MOVEMBET 1507		,
			¥
		4	
			*
<u> </u>			
<u></u>		mly members are listed	in annex.
Special ca		t published after the int	
"A" docum	dered to be of marketillar selectores	te and not in conflict wi stand the principle or th	
"E" carlier	document but published on or after the international	particular relevance; the	deimed invention
ming	cannot be con	nsidered novel or cannot ventive step when the do	be considered to
which	is cited to establish the publication date of another "Y" document of	particular relevance; the	claimed invention
"O" docum	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is	nsidered to involve an in combined with one or m	ore other such docu-
omet	means ments, such onent published prior to the international filing date but in the art.	ombination being obvio	us to a person skilled
later	than the priority date claimed *&* document me	mber of the same patent	family
Date of the	e actual completion of the international search Date of mailing	ng of the international se	arch report
3	30 November 1993	·	15. 12.93
Name and	mailing address of the ISA Authorized of		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	uce.	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	on The Nabica	. N
<u> </u>	Fax: (+31-70) 340-3016 NGUY	en The Nghiep	,π

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inten_uonal Application No
PCT/EP 93/02538

Patent document cited in search report	Publication date	Patent memi		Publication date
EP-A-0459541	04-12-91	DE-A- JP-A-	4013483 4228579	31-10-91 18-08-92
JP-A-62260073	12-11-87	NONE		

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internacionales Aktenzeichen

PCT/EP 93/02538

A. KLASS	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C25D11/36		:
2	C23011730		
1	tternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K RCHIERTE GEBIETE	Jassifikation und der IPK	
Recherchies	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	pole)	
IPK 5	C25D C23C	•	
			•
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen, s	owert diese unter die recherchierten Gebie	te fallen
] ·			
			<u> </u>
Wahrend de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evil. verwendet	e Suchbegriffe)
		•	
CAISW	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	he der in Betrecht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
			Bed. Anspruch Nr.
A	EP,A,O 459 541 (METALLGESELLSCHAF	T AC) A	
	Dezember 1991	1 AG) 4.	
	in der Anmeldung erwähnt		
A:	CUENICAL ADCIDACTO	10	
^-	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 108, no. März 1988, Columbus, Ohio, US;	. 12,	
	abstract no. 99045b,		
·	YAMAGATA 'phosphating of iron all	loy¹	
	Seite 290 ; in der Anmeldung erwähnt		
	siehe Zusammenfassung		
	& JP,A,62 260 073 (YĀMATA MOTOR (CO) 12.	*
	November 1987		
		.*	*
·			
			*
	V-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-		, 141
entn	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentiamilie	
Besondere	Kategonen von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.	T Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Priontätsdatum veröffentlich	
aber n	acut als desonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern n Erfindung zugrundeliegenden Prinzips	ur zumVerständnis des der
- Anne	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede	
	mulchung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweiselhaft er-	kann allein aufgrund dieser Veröffend	ichung nicht als neu oder auf
	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig	utung die beanspruchte Erfindung
O' Veroii	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie is	it einer oder mehreren anderen
P Veröff	entizung, eine Ausstellung oder andere Malinahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann *& Veröffentlichung, die Mitglied derselb	naheliegend ist
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
			* *
3	O. November 1993	1 5. 1	<u>, 30</u>
Name und	Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
·	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Nguyen The Nghier	o, N
Formhiatt PCT	/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)	<u> </u>	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inten_onales Aktenzeichen
PCT/EP 93/02538

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP-A-0459541	04-12-91	DE-A- JP-A-	4013483 4228579	31-10 - 91 18-08 - 92	
JP-A-62260073	12-11-87	KEINE			

Formbiatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentiamilie)(Juli 1992)

BNSDOCID: <WO_____9408074A1_I >